PHOTOSENSITIVE RESIN COMPOSITION FOR FORMING LIGHT SHIELDING FILM, BLACK MATRIX FORMED USING SAME AND ITS **PRODUCTION**

Patent Number:

JP9166869

Publication date: 1997-06-24

Inventor(s):

UCHIGAWA KIYOSHI; SHINODA MASARU; ONODERA JUNICHI; KOMANO

HIROSHI

Applicant(s):

TOKYO OHKA KOGYO CO LTD

Requested

Patent:

__ JP9166869

Application

Number:

JP19960289312 19961012

Priority Number

(s):

IPC

G03F7/004; C09C1/56; C09C3/10; G02B5/00; G02B5/20; G02F1/1335; G03F7/027;

Classification:

G03F7/028; G03F7/033; H01J9/227

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a photosensitive resin compsn. having a high OD value and capable of forming a black matrix causing no leak of electric current by using resin coated carbon black as a light shielding pigment.

SOLUTION: This photosensitive resin compsn. contains a polymer binder, a photopolymerizable monomer, a photopolymn, initiator and resin coated carbon black as a light shielding pigment. The resin coated carbon black is produced, e.g. by mixing carbon black with a resin having reactivity with carboxyl. hydroxyl and carbonyl groups existing on the surface of the carbon black and heating the resultant mixture at 50-380 deg.C.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-166869

(43)公開日 平成9年(1997)6月24日

(51) Int.Cl. ^a		徽別記号		FI			技術表示箇所		
G03F	7/004	505		G 0 3	F	7/004		505	
C09C	1/56	PBJ		C 0 9	С	1/56	•	PBJ	
	3/10	PBX				3/10		PBX	
G 0 2 B	5/00			G 0 2	В	5/00		В	
	5/20	101				5/20		101	
		•	審查請求	未請求	請求項	頁の数8	FD	(全 9 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		特願平8-289312		(71)出	頭人	000220	239		
						東京広	化工業	朱式会社	
(22)出顧日		平成8年(1996)10月12日			٠	神奈川	県川崎	市中原区中丸	子150番地
				(72)発	明者	内河	喜代司		
(31)優先権主張番号		特願平7-291909				神奈川	県川崎	市中原区中丸	子150番地 東
(32)優先日		平7 (1995)10月13日	京広化工業株式会社内						
(33)優先權主張国		日本 (JP)	(72)発	(72)発明者 信太 勝					
						神奈川	県川崎	市中原区中丸	子150番地 東
						京応化工業株式会社内			
				(72)発	明者	小野寺	純一		
						神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東			
						京店化	工業株	式会社内	
				(74)代	理人	弁理士	服部	平八	
									最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 遮光膜形成用感光性樹脂組成物、該遮光膜形成用感光性樹脂組成物で形成されたプラックマトリックス、及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】高い画像コントラストを維持するとともに、電 気絶縁性にも優れたブラックマトリックスを提供できる 遮光膜形成用感光性樹脂組成物、遮光膜形成用感光性樹 脂組成物を用いて形成したブラックマトリックス、及び その製造方法を提供すること。

【解決手段】(a) 高分子バインダー、(b) 光重合性モノマー、(c) 光重合開始剤および(d) 遮光性顔料を含有する遮光膜形成用感光性樹脂組成物において、前記(d) 遮光性顔料が樹脂被覆されたカーボンブラックである遮光膜形成用感光性樹脂組成物、該遮光膜形成用感光性樹脂組成物を用いて形成したブラックマトリックス、及びその製造方法。

【特許請求の範囲】

【請求項1】(a) 高分子バインダー、(b) 光重合性 モノマー、(c)光重合開始剤および(d)遮光性顔料 を含有する遮光膜形成用感光性樹脂組成物において、前 記(d) 遮光性顔料が樹脂被覆されたカーボンブラック であることを特徴とする遮光膜形成用感光性樹脂組成

【請求項2】カーボンブラックを被覆する樹脂が、エポ シキ基、チオエポキシ基、オキサゾリン基、アジリジン 基及びヒドロキシアルキルアミド基から選ばれる少なく 10 とも1種の反応性基を有するモノマーを重合成分とする 樹脂であることを特徴とする請求項1記載の遮光膜形成 用感光性樹脂組成物。

【請求項3】カーボンブラックとその被覆樹脂とが重量 比で50:1~1:1であることを特徴とする請求項1 記載の遮光膜形成用感光性樹脂組成物。

【請求項4】カーボンブラックとその被覆樹脂とが重量 比で30:1~2:1であることを特徴とする請求項1 記載の遮光膜形成用感光性樹脂組成物。

比で20:1~3:1であることを特徴とする請求項1 記載の遮光膜形成用感光性樹脂組成物。

【請求項6】高分子バインダー、光重合性モノマー、光 重合開始剤および樹脂被覆されたカーボンブラックから なる遮光性顔料を含有する遮光膜形成用感光性樹脂組成 物で形成されたブラックマトリックス。

【請求項7】ブラックマトリックスの遮光率がOD値で 少なくとも1.5、電気絶縁抵抗値が少なくとも10° Ω/□である請求項6記載のブラックマトリックス。

【請求項8】高分子バインダー、光重合性モノマー、光 30 重合開始剤および樹脂被覆されたカーボンブラックから なる遮光性顔料を含有する遮光膜形成用感光性樹脂組成 物を基板上に塗布し、それに活性光線を選択的に照射し たのち、アルカリ性水溶液で現像しバターンを形成する ことを特徴とするプラックマトリックスの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、遮光膜形成用感光 性樹脂組成物、該遮光膜形成用感光性樹脂組成物で形成 されたブラックマトリックス、及びその製造方法、さら に詳しくは電気絶縁性に優れ、液晶パネル、プラズマデ ィスプレイパネル等のブラックマトリックスを形成する のに好適な進光膜形成用感光性樹脂組成物、該遮光膜形 成用感光性樹脂組成物で形成されたブラックマトリック ス、及びその製造方法に関する。

[0002]

【従来技術】液晶パネル、特にTN方式、STN方式の 液晶パネルは、画像のコントラストを強調するためのブ ラックマトリックスがガラス基板上に設けられ、その上 に透明保護膜、透明電極、配向膜、液晶、透明電極、透 50

明保護膜、バックライトなどが順次積層されているとと もに、前記部材の端部の気密性を保持するためシール部 が設けられた構造となっている。特にカラー液晶パネル にあってはさらにカラーフィルタも設置されている。と うした液晶パネルが高コントラストの画像を維持するた めには、ブラックマトリックスの遮光率がOD値で1. 5以上である必要がある。しかもカラーフィルタや透明 保護膜の平坦化の問題から、前記ブラックマトリックス はできるだけ薄いものが求められている。ブラックマト リックスは、遮光性顔料と感光性樹脂とを含有する遮光 膜形成用感光性樹脂組成物を溶剤等に溶解し、それを液 晶パネル基板上に塗布、乾燥したのち、ホトリソグラフ ィー法で形成されるが、薄く、しかも高〇D値を有する プラックマトリックスとするためには、優れた遮光性を 有する顔料を用いることが必須であり、遮光率の大きな カーボンブラックが通常使用されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】上記従来のブラックマ トリックスを備えたSTNなどの単純マトリックス液晶 【請求項5】カーボンブラックとその被覆樹脂とが重量 20 パネル、又はTFTオンアレイディスプレイにあって は、表示画像の不均一さをなくすため液晶を挟んだ透明 電極間の電圧を平均化することが必要である。ところ が、カーボンブラックが導電性を有するところから電流 が透明電極からブラックマトリックスにリークすること が起こり、電圧の平均化が難しく、バッテリーなどにより る作動時間を長くすることができなかった。その上、液 晶パネルのシール部からは構造的に電流がリークし易く なっており前記電圧の均一化を一層困難なものにしてい た。こうした問題を解決するため、チタンブラック等の 無機顔料やベリレンブラック等の有機顔料を配合した遮 光膜形成用感光性樹脂組成物が提案されたが、高〇D値 を得ることが難しく、高コントラストを得るにはブラッ クマトリックス層を厚くする必要があった。その結果カ ラーフィルタや透明保護膜の平坦化が困難となり、表示 画像に不均一さが発生するといった欠点が生じた。

> 【0004】こうした現状に鑑み、本発明者等は鋭意研 究を続けた結果、樹脂被覆されたカーボンブラックを遮 光膜形成用感光性樹脂組成物に含有させることで上記問 題点が解決できることを見出し、本発明を完成したもの である。すなわち

> 【0005】本発明は、高〇D値を有し、しかも電流の リークのないブラックマトリックスを形成する遮光膜形 成用感光性樹脂組成物を提供することを目的とする。

> 【0006】また、本発明は、上記遮光膜形成用感光性 樹脂組成物で形成されたブラックマトリックスを提供す ることを目的とする。

【0007】さらに、本発明は、上記ブラックマトリッ クスの製造方法を提供することを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成する本発

明は、(a) 髙分子バインダー、(b) 光重合性モノマ ー、(c)光重合開始剤および(d)樹脂被覆カーボン ブラック遮光性顔料を含有することを特徴とする遮光膜 形成用感光性樹脂組成物、該遮光膜形成用感光性樹脂組 成物で形成されたブラックマトリックス、及びその製造 方法に係る。

【0009】以下本発明を詳細に説明する。上記遮光膜 形成用感光性樹脂組成物に用いられる(a)髙分子バイ ンダーとしては、現像の容易さからアルカリ現像が可能 なバインダーが好ましく、具体的にアクリル酸、メタク リル酸などのカルボキシル基を有するモノマーと、アク リル酸メチル、メタクリル酸メチル、アクリル酸エチ ル、メタクリル酸エチル、2-ヒドロキシエチルアクリ レート、2-ヒドロキシエチルメタクリレート、2-ヒ ドロキシプロピルメタクリレート、N-ブチルアクリレ ート、N-プチルメタクリレート、イソプチルアクリー ト、イソプチルメタクリレート、ベンジルアクリレー ト、ベンジルメタクリレート、フェノキシアクリレー ト、フェノキシメタクリレート、イソボルニルアクリレ ート、イソボルニルメタクリレート、グリシジルメタク リレート、スチレン、アクリルアミド、アクリロニトリ ルなどとの共重合体、およびフェノールノボラック型エ ポキシアクリレート重合体、フェノールノボラック型エ ポキシメタクリレート重合体、クレゾールノボラック型 エポキシアクリレート重合体、クレゾールノボラック型 エポキシメタクリレート重合体、ピスフェノールA型エ ポキシアクリレート重合体、ビスフェノールS型エポキ シアクリレート重合体などの樹脂が挙げられる。前記樹 脂にはアクリロイル基またはメタクリロイル基が導入さ れているところから架橋効率が高められ塗膜の耐光性、 耐薬品性が優れている。前記樹脂を構成するアクリル 酸、メタクリル酸などのカルボキシル基を有するモノマ 一成分の含有量は5~40重量%の範囲がよい。

【0010】上記(a)成分は、高分子バインダー、光 重合性モノマーおよび光重合開始剤の合計100重量部 中10~60重量部の範囲で配合されるのがよく、前記 配合量が10重量部未満では塗布、乾燥時に膜を形成し 難く、硬化後の被膜強度を十分高めることができない。 また、配合量が60重量部を超えると現像性が低下す る。

【0011】また、(b) 光重合性モノマーとしては、 メチルアクリレート、メチルメタクリレート、2-ヒド ロキシエチルアクリレート、2-ヒドロキシエチルメタ クリレート、2-ヒドロキシプロピルメタクリレート、 エチレングリコールジアクリレート、エチレングリコー ルジメタクリレート、トリエチレングリコールジアクリ レート、トリエチレングリコールジメタクリレート、テ トラエチレングリコールジアクリレート、テトラエチレ ングリコールジメタクリレート、プロピレングリコール

ト、トリメチロールプロパントリアクリレート、トリメ チロールプロパントリメタクリレート、テトラメチロー ルプロパンテトラアクリレート、テトラメチロールプロ パンテトラメタクリレート、ペンタエリスリトールトリ アクリレート、ペンタエリスリトールトリメタクリレー ト、ペンタエリスリトールテトラアクリレート、ペンタ エリスリトールテトラメタクリレート、ジベンタエリス リトールペンタアクリレート、ジペンタエリスリトール ペンタメタクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ 10 アクリレート、ジベンタエリスリトールヘキサメタクリ レート、1,6-ヘキサンジオールジアクリレート、ベ ンジルアクリレート、ベンジルメタクリレート、カルド エポキシジアクリレート、アクリル酸、メタクリル酸等 が挙げられるが、これらに限定されるものではない。前 記(b)成分は、高分子バインダー、光重合性モノマ 一、光重合開始剤の合計100重量部当り15~50重 量部の範囲で配合されるととが好ましく、配合量が15 重量部未満では光硬化不良を起こし十分な耐熱性、耐薬 品性を得ることができず、また50重量部を超えると塗 膜形成能が劣ることになる。

【0012】さらに、(c)光重合開始剤としては、1 ーヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、2,2-ジメトキシー1、2 - ジフェニルエタン-1-オン、2 ーメチルーー1ー〔4ー(メチルチオ)フェニル〕-2 -モルフォリノプロパン-1-オン、2-ベンジル-2. ージメチルアミノー 1 - (4 - モルフォリノフェニル) ーブタンー1ーオン、2-ヒドロキシー2-メチルー1 **−フェニルプロパン−1−オン、2,4,6−トリメチ** ルベンゾイルジフェニルホスフィンオキシド、1-〔4 - (2-ヒドロキシエトキシ)フェニル)-2-ヒドロ キシー2ーメチルー1ープロパンー1ーオン、2、4ー ジエチルチオキサントン、2-クロロチオキサントン、 2, 4-ジメチルチオキサントン、3, 3-ジメチルー 4-メトキシベンゾフェノン、ベンゾフェノン、1-ク ロロー4ープロポキシチオキサントン、1-(4-イソ プロピルフェニル) -2-ヒドロキシ-2-メチルプロ パン-1-オン、1-(4-ドデシルフェニル)-2-ヒドロキシー2-メチルプロパン-1-オン、4-ベン ゾイルー4゜ーメチルジメチルスルフィド、4ージメチ 40 ルアミノ安息香酸、4-ジメチルアミノ安息香酸メチ ル、4-ジメチルアミノ安息香酸エチル、4-ジメチル アミノ安息香酸ブチル、4-ジメチルアミノ-2-エチ ルヘキシル安息香酸、4-ジメチルアミノ-2-イソア ミル安息香酸、2、2-ジエトキシアセトフェノン、ベ ンジルジメチルケタール、ベンジル-β-メトキシエチ ルアセタール、1-フェニル-1,2-プロパンジオン -2-(o-エトキシカルボニル)オキシム、o-ベン ゾイル安息香酸メチル、ビス(4-ジメチルアミノフェ ニル)ケトン、4、4'-ビスジエチルアミノベンゾフ ジアクリレート、プロピレングリコールジメタクリレー 50 ェノン、4,4'ージクロロベンゾフェノン、ベンジ

ル、ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾイ ンエチルエーテル、ベンゾインイソプロビルエーテル、 ベンゾイン・nープチルエーテル、ベンゾインイソブチ ルエーテル、ベンゾインブチルエーテル、pージメチル アミノアセトフェノン、p-tert-ブチルトリクロ ロアセトフェノン、p-tert-ブチルジクロロアセ トフェノン、チオキサントン、2-メチルチオキサント ン、2-イソプロピルチオキサントン、ジベンゾスベロ ン、α, α-ジクロロ-4-フェノキシアセトフェノ ン、ペンチルー4ージメチルアミノベンゾエート、9ー フェニルアクリジン、1,7-ビス-(9-アクリジニ ル) ヘプタン、1,5-ビスー(9-アクリジニル) ペ ンタン、1、3-ビス-(9-アクリジニル)プロパ ン、2、4-ビス-トリクロロメチル-6-(3-ブロ モー4ーメトキシ) フェニルーs-トリアジン、2,4 -ビスートリクロロメチル-6-(2-プロモ-4-メ トキシ) フェニルーs-トリアジン、2, 4-ビスート リクロロメチルー6-(3-ブロモ-4-メトキシ)ス チリルフェニル-s-トリアジン、2,4-ビス-トリ クロロメチルー6-(2-ブロモ-4-メトキシ)スチ 20 リルフェニルー s ートリアジンなどを挙げることができ る。

【0013】上記(c)成分の配合量は高分子パインダ ー、光重合性モノマー、光重合開始剤の合計100重量 部中0.1~30重量部の範囲で配合することができ る。

【0014】本発明の遮光膜形成用感光性樹脂組成物に 配合する(d) 遮光性顔料としては表面が樹脂被覆され たカーボンブラックを使用するが、前記樹脂被覆カーボ ンブラックは、カーボンブラックとカーボンブラック表 30 面に存在するカルボキシル基、ヒドロキシル基、カルボ ニル基と反応性を有する樹脂を混合し、それを50~3 80℃の温度で加熱する被覆方法、カーボンブラックと 前記残基と反応性を有するラジカル重合又はラジカル共 重合し得るエチレン性モノマーとを水-有機溶剤混合系 または水ー界面活性剤混合系に分散し、重合開始剤の存 在下で前記モノマーを重合する被覆方法、メラミン樹 脂、アルキド樹脂、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ウレ タン樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリスチレン樹脂、ア クリロニトリル・ブタジエン・スチレン樹脂などをCV 40 D、PVD法などの気相合成法により被覆する方法など で製造される。前記カーボンブラックとしては、公知の 各種製造方法で製造されたカーボンプラックが使用でき るが、チャンネルブラック、ファーネスブラック、サー マルブラック、ランブブラックが好ましく、中でもチャ ンネルブラックやファーネスブラックがよい。特に高カ ラーチャンネルブラックは遮光性能に優れるとともに、 樹脂被覆性にも優れ好適である。このカーボンブラック を被覆する樹脂としては、カーボンブラックの表面に存 在するカルボキシル基、ヒドロキシル基、カルボニル基 50

に対し反応性を有する、例えばエポキシ基、チオエポキ シ基、オキサゾリン基、アジリジン基、ヒドロキシアル キルアミド基などを有するモノマーの一種または二種以 上を重合成分とする樹脂が挙げられる。中でも、反応性 基がエポキシ基またはチオエポキシ基を有するモノマー から得られた樹脂はカーボンブラック表面との反応性が 高く好ましい。前記反応性基を有するモノマーとしては 次の化1~19の化合物

[0015]

【化1】

[0016]

[{t2]

[0017]

【化31

[0018]

[化4]

[0019]

[化5]

[0020]

【化6】

[0021]

[167]

[0022]

[化8]

[0023]

[化9]

物をいう。

[0024] 【化10】

[0025] 【化111

[0026] 【化12】

[0027] (化13)

[0028] (化14) CH_= C (CH_)-NHCO

【化15】 CH₂= CH-COO-CH₂CH₂·

【化16】 CH₄=C (CH₆)-COO-CH₂CH₄

[0031] 【化17]

CH₂= CH-COO-CH₂CH₃

[0032] 【化18】

[0029]

[0030]

CH2=C (CH3)-COO-CH2CH2

[0033] 【化19】

および2-ビニル-2-オキサゾリン、2-ビニル-4 -メチル-2-オキサゾリン、2-ビニル-5-メチル -2-オキサゾリン、2-ピニル-4-エチル-2-オ キサゾリン、2-ビニル-5-エチル-2-オキサゾリ ン、2-イソプロペニル-2-オキサゾリン、2-イソ プロペニルー4ーメチルー2ーオキサゾリン、2ーイソ プロペニルー5-メチルー2-オキサゾリン、2-イソ プロペニルー4-エチルー2-オキサゾリン、2-イソ プロペニル-5-エチル-2-オキサゾリン、2-イソ 10 プロペニルー4, 5-ジメチルー2-オキサゾリン、N -ヒドロキシメチルアクリルアミド、N-ヒドロキシエ チルアクリルアミド、N-ヒドロキシブチルアクリルア ミド、N-ヒドロキシイソプチルアクリルアミド、N-ヒドロキシ-2-エチルヘキシルアクリルアミド、N-ヒドロキシメチルメタクリルアミド、N-ヒドロキシメ チルメタクリルアミド、N-ヒドロキシエチルメタクリ ルアミド、N-ヒドロキシブチルメタクリルアミド、N -ヒドロキシイソプチルメタクリルアミド、N-ヒドロ キシ-2-エチルヘキシルメタクリルアミド、N-ヒド 20 ロキシシクロヘキシルメタクリルアミドなどが挙げられ る。前記モノマーを重合成分とするとは、前記モノマー の単独又は前記モノマーと共重合性のモノマーとの混合

【0034】上記樹脂被覆カーボンブラックを製造する にあたって、該カーボンブラックの分散性を良好にする ためポリウレタン系、ポリエステル系、ポリアミド系、 ポリスチレン系、ポリオレフィン系などのエラストマー を添加してもよい。また、使用する溶剤としては、アル コール類、ケトン類、エーテル類およびアミン類など 30 が、重合開始剤としては、二酸化硫黄、過硫酸カリウ

ム、アゾビスシアノ吉草酸、アゾビスイソブチロニトリ ルなど従来公知の重合開始剤が挙げられる。

【0035】一般に、遮光膜形成用感光性樹脂組成物を 塗布して形成したブラックマトリックスが高コントラス トの画像を維持するためには、遮光率が〇D値で1、5 以上、好ましくは2.0以上、さらに好ましくは2.5 以上であることを必要とするといわれている。また電流 等のリークを防ぐためにはブラックマトリックスの抵抗 値が少なくとも10Ω"/□でなければならない。

40 【0036】(a)~(c)成分からなる遮光膜形成用 感光性樹脂組成物の総量100重量部中に添加するカー ボンブラック量と〇 D値との間には図1の比例関係が成 立するので、ブラックマトリックスの遮光率をOD値で 1. 5以上とするためには、カーボンブラックの量は (a)~(c)成分の総量100重量部に対し少なくと も20重量部配合することが必要である。

【0037】また、カーボンブラック100重量部に対 する被覆樹脂量とそのときの抵抗値(♀/□)には図2 の関係が成立するが、電流等のリークを防ぐためにはブ

50 ラックマトリックスの抵抗値が少なくとも10Q゚/□

20

でなければならないところから、カーボンブラック10 0重量部に対する被覆樹脂量が100重量部を超える と、カーボンブラックの均一な分散ができなくなるの で、被覆樹脂顔料を前記範囲以下にする必要がある。 【0038】すなわち、カーボンブラックと被覆樹脂と の割合は重量比で50:1~1:1とする必要がある。 特にカーボンブラックの分散性を考慮すると前記割合は 30:1~2:1、好ましくは20:1~3:1の範囲 がよい。

おいて、樹脂被覆カーボンブラックに加えて、色調を整 えたり、更なる高抵抗値化のために遮光性能を低下させ ない範囲で他の顔料を添加することができる。このよう な顔料としてはカラーインデックス(C. 1.) ナンバ

黄色顔料: C. I. 20、24、83、86、93、 109, 110, 117, 125, 137, 138, 1 39, 147, 148, 153, 154, 166, 16,

橙色顔料: C. I. 36、43、51、55、59、 61

赤色顔料: C. I. 9、97、122、123、14 9, 168, 177, 180, 192, 215, 21 6、又は217、220、223、224、226、2 27, 228, 240

紫色顔料: C. I. 19、23、29、30、37、 40.50

青色顔料: C. I. 15, 16, 22, 60, 64

緑色顔料:C. I. 7,36

茶色顔料:C. I. 23, 25, 26

として表される顔料が好適に使用できる。

【0040】本発明の遮光膜形成用感光性樹脂組成物に 添加される顔料の量は、樹脂被覆カーボンブラック量を も含めて、高分子バインダー、光重合性モノマー、光重 合開始剤の合計100重量部に対して20~150重量 部、好ましくは25~100重量部、さらに好ましくは 30~80重量部の範囲がよい。前記範囲が20重量部 未満では、ブラックマトリックスが十分な遮光性を有す ることができず、また、150重量部を超えると感光性 マトリックスを形成することができない。

【0041】上記に加えて、本発明の遮光膜形成用感光 性樹脂組成物には、塗布性の改善、粘度調整のため有機 添加剤を配合できる。前記有機添加剤としては、ベンゼ ン、トルエン、キシレン、メチルエチルケトン、アセト ン、メチルイソプチルケトン、シクロヘキサノン、メタ ノール、エタノール、プロパノール、ブタノール、ヘキ サノール、シクロヘキサノール、エチレングリコール、 ジエチレングリコール、グリセリン、エチレングリコー

エーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、 プロピレングリコールモノエチルエーテル、ジェチレン グリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコール モノエチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエ ーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、3-メトキシブチルアセテート、3-メチル-3-メトキシ ブチルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエ ーテルプロピオネート、プロピレングリコールモノエチ ルエーテルプロピオネート、炭酸メチル、炭酸エチル、 【0039】本発明の遮光膜形成用感光性樹脂組成物に 10 炭酸プロピル、炭酸プチルなどが挙げられる。中でも3 ーメトキシブチルアセテートは遮光膜形成用感光性樹脂 組成物中の可溶成分に対して優れた溶解性を示すのみな らず、顔料などの不溶性成分の分散性を良好にするとこ ろから好適である。前記有機添加剤は高分子バインダ ー、光重合性モノマー、光重合開始剤および遮光性顔料 の合計100重量部に対して50~500重量部の範囲 で用いることができる。

> 【0042】本発明の遮光膜形成用感光性樹脂組成物の 使用方法を以下に示す。すなわち

(1) 遮光膜形成用感光性樹脂組成物の調製 高分子バインダー、光重合性モノマー、光重合開始剤、 顔料、必要に応じて有機添加剤等を加えて3本ロールミ ル、ボールミル、サンドミル等でよく分散、混練し、遮 光膜形成用感光性樹脂組成物を調製する。

【0043】(2) 遮光膜形成用感光性樹脂組成物の塗

上記調製した遮光膜形成用感光性樹脂組成物をあらかじ め洗浄した清浄な表面を有するガラス基板上に、ロール コーター、リバースコーター、バーコーター等の接触転 30 写型塗布装置やスピンナー、カーテンフローコータ等の 非接触型塗布装置を用いて塗布する。

【0044】上記調製および塗布において、ガラス基板 と遮光膜形成用感光性樹脂組成物との密着性を向上させ るためシランカップリング剤を配合するまたは前記基板 に塗布しておくことができる。

【0045】(3) ブラックマトリックスの製造 上記塗布後、室温にて数時間~数日放置するか、または 温風ヒーター、赤外線ヒーター中に数十分~数時間入れ て溶剤を除去したのち、塗布膜厚を0.5~5μmの範 樹脂成分の量が減少し硬化不良を起とし良好なブラック 40 囲に調整し、次いでネガマスクを介して、紫外線、エキ シマレーザー光等の活性性エネルギー線を照射エネルギ -線量100~2000mJ/cm2の範囲で露光す る。前記照射エネルギー線量は用いる感光性樹脂組成物 の種類に応じて若干変えることがある。露光して得た疎 光膜を、現像液を用いて浸漬法、スプレー法等で現像し ブラックマトリックスパターンを形成する。現像に使用 する現像液としては、モノエタノールアミン、ジェタノ ールアミン、トリエタノールアミン等の有機系のもの や、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウ ルモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチル 50 ム、アンモニア、4級アンモニウム塩等の水溶液が挙げ

特開平9-166869

*べるがこれによって本発明はなんら限定されるものでは

られる。

【0046】上記の製造方法で得られたブラックマトリ ックスは、液晶パネル、プラズマディスプレイパネル 等、様々な表示装置用として有用である。

[0047]

ない。 [0048]

【実施例】

実施例1

【発明の実施の形態】以下に本発明の実施例について述*

下記に示される遮光膜形成用感光性樹脂組成物、

・メタクリル酸/メタクリル酸メチル共重合体(25/75重量%比、

重量平均分子量約20000)

30重量部

・ビスフェノールA型エポキシアクリレート樹脂(重量平均

分子量約3000)

20重量部

・トリメチロールプロパントリアクリレート

20重量部

・2-メチル-1-〔4-(メチルチオ)フェニル〕-2-モルホリノプロパン-1-オン(チバガイギー社製:

IRGACURE 907)

9重量部

・9-フェニルアクリジン

5重量部

・4、4'ービスジエチルアミノベンゾフェノン

4重量部

・樹脂被覆カーボンブラック(御国色素社製EX-1455-90、

カーボンブラック:被覆樹脂重量比10:1.1)

40重量部

・ファストゲンブルー GS (大日本インキ化学社製)

5重量部

・3-メトキシブチルアセテート

150重量部

を3本ロールミルを用いて2時間分散、混練した。 【0049】得られた遮光膜形成用感光性樹脂組成物を 厚さ0.5mmのガラス基板上にリバースコーター(大 日本スクリーン社製:ラウンドコーター)を用いて乾燥 膜厚1μmとなるように塗布し80℃で1分間乾燥させ た。その後、1000mJ/cm'の紫外線を全面照射 して露光したのち250℃、30分間ポストベークし た。この基板の遮光率を測定したところ〇D値で2.5 であり、抵抗値は5.2×10¹³Ω/□であった。ま のない優れたものであった。

【0050】次に上記調製した遮光膜形成用感光性樹脂 組成物を乾燥膜厚1μmとなるように塗布し、乾燥して 得た0.7mmのガラス基板上に20μmライン/80 μmスペースを再現するようなマスクを介して1000 mJ/cm²の紫外線を照射し露光したのち250℃、 30分間ポストベークした。露光基板を炭酸ナトリウム 0.5%水溶液で25℃、60秒間スプレー現像した。 露光部にはカケ、ハガレ等みられず未露光部にも残渣の ない良好なブラックマトリックスパターンが得られた。 これを用いて液晶パネルを作製したが、電流のリークが なく、均一な表示画像が再現できた。

【0051】実施例2

実施例1において樹脂被覆カーボンブラック(御国色素 社製EX-1455-90)40重量部のかわりに、樹 脂被覆カーボンブラック(御国色素社製EX-1455 - 70、カーボンブラック:被覆樹脂重量比70:3 0)40重量部を使用した以外は実施例1と同様にして 遮光膜を製造した。遮光率は0D値で2. であり、抵抗

られた遮光膜にはピンホールや、色ムラ等のない優れた **ブラックマトリックスであった。このブラックマトリッ** クスを用いて液晶パネルを作製したところ、電流のリー クががなく、均一な表示画像が再現できた。

【0052】実施例3

実施例1において樹脂被覆カーボンブラック(御国色素 社製EX-1455-90) 40重量部のかわりに、樹 脂被覆カーボンブラック(御国色素社製EX-1455 -96、カーボンブラック:被覆樹脂重量比96:4) た、基板に設けられた遮光膜にはピンホールや色ムラ等 30 40重量部を使用した以外は実施例1と同様にして遮光 膜を製造した。遮光率はOD値で2.5であり、抵抗値 は7. 4×10°Q/□であった。また、基板に設けら れた遮光膜にはピンホールや、色ムラ等のない優れたブ **ラックマトリックスであった。このブラックマトリック** スを用いて液晶パネルを作製したところ、電流のリーク ががなく、均一な表示画像が再現できた。

【0053】実施例4

実施例1において樹脂被覆カーボンブラック(御国色素 社製EX-1455-90) 40重量部のかわりに、樹 脂被覆カーボンブラック(御国色素社製EX-1455 -97、カーボンブラック:被覆樹脂重量比97:3) 40重量部を使用した以外は実施例1と同様にして遮光 膜を製造した。遮光率はOD値で2.5であり、抵抗値 は1.3×10°Q/□であった。また、基板に設けら れた遮光膜にはピンホールや、色ムラ等のない優れたブ ラックマトリックスであった。 このブラックマトリック スを用いて液晶パネルを作製したところ、電流のリーク ががなく、均一な表示画像が再現できた。

【0054】実施例5

値は $1.3 imes 10^{11}\Omega$ / \square であった。また、基板に設け 50 実施例1において樹脂被覆カーボンブラック(御国色素

社製EX-1455-90) 40重量部のかわりに、樹 脂被覆カーボンブラック(御国色素社製EX-1455 -60、カーボンブラック:被覆樹脂重量比60:4 0)40重量部を使用した以外は実施例1と同様にして 遮光膜を製造した。遮光率は〇D値で1.9であり、抵 抗値は3. 3×10¹⁵Q/□であった。また、基板に設 けられた遮光膜にはピンホールや、色ムラ等のない優れ たブラックマトリックスであった。このブラックマトリ ックスを用いて液晶パネルを作製したところ、電流のリ ークががなく、ややコントラストが低下したものの均一 10 な表示画像が再現できた。

【0055】比較例1

実施例1において樹脂被覆カーボンブラック (御国色素 社製EX-1455-90) 40重量部のかわりに樹脂 被覆のないカーボンブラック(御国色素社製EX-71 9)36重量部を使用して遮光膜を得た。遮光率はOD 値で2.5であり、抵抗値は4.8×10°Ω/□であ った。また、基板に設けられた遮光膜にはピンホール や、色ムラ等はみられなかった。前記遮光膜を用いて作 成したブラックマトリックスで液晶パネルを製造したと 20 トリックスは高い画像コントラストを維持するととも ころ、電流のリーク等がみられ、表示画像の明るさも不 均一であった。

【0056】比較例2

3.0

2.5

20

1.5

LO

0,5

(原阿1 中田)

章 G0

実施例1において樹脂被覆カーボンブラック(御国色素 社製EX-1455-90) 40重量部のかわりに、樹 脂被覆カーボンブラック(御国色素社製EX-1455 -99、カーボンブラック:被覆樹脂重量比100: 1) 40重量部を使用した以外は実施例1と同様にして 遮光膜を得た。遮光率は〇D値で2.5であり、抵抗値 は2. $7 \times 10^{7} \Omega / \Box$ であった。また、基板に設けら れた遮光膜にはピンホールや、色ムラ等はみられなかっ* *たものの、この遮光膜を用いて作成したブラックマトリ ックスで液晶パネルを製造したところ、電流のリーク等 がみられ、表示画像の明るさも不均一であった。

【0057】比較例3

実施例1において樹脂被覆カーボンブラック (御国色素 社製EX-1455-90) 40重量部のかわりに、樹 脂被覆カーボンブラック(御国色素社製EX-1455 - 40、カーボンブラック:被覆樹脂重量比40:6 0) 40 重量部を使用した以外はは実施例1と同様にし て遮光膜を製造した。遮光率はOD値で1.1であり、 抵抗値は8. 2×10¹¹ Ω/□であった。基板に設けら れた遮光膜にはピンホールや、色ムラ等はみられなかっ たものの、この遮光膜を用いて作成したブラックマトリ ックスで液晶パネルを製造したところ、画面のコントラ ストの低い液晶パネルであった。

[0058]

【発明の効果】本発明の遮光膜形成用感光性樹脂組成物 は、遮光顔料として導電性を抑えた樹脂被覆カーボンブ ラックを含有し、該組成物を用いて形成したブラックマ に、電気絶縁性にも優れた特性を示し、良好な液晶パネ ル、プラズマディスプレイパネル等を製造できる。前記 ブラックマトリックスは遮光膜形成用感光性樹脂組成物 を基板上に塗布し、それに活性光線を選択的に照射した のち、アルカリ性水溶液で現像しパターンを形成すると とで容易に製造でき、工業的にも優れている。

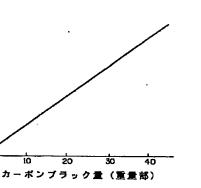
【図面の簡単な説明】

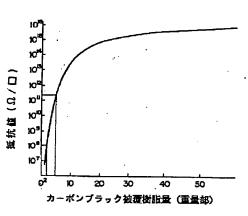
【図1】カーボンブラック量とOD値の関係を示す図で ある。

【図2】カーボンブラック被覆樹脂量と抵抗値の関係を 示す図である。

【図2】

【図1】





フロントページの続き

	識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
1/1335	500		G02F	1/1335	500	
7/027	502		G03F	7/027	502	
7/028				7/028	•	
7/033				7/033		
9/227	•		H O 1 J	9/227	D D	
	7/027 7/028 7/033	1/1335 5 0 0 7/027 5 0 2 7/028 7/033	1/1335 5 0 0 7/027 5 0 2 7/028 7/033	1/1335 5 0 0 G 0 2 F 7/027 5 0 2 G 0 3 F 7/028 7/033	1/1335 5 0 0 G 0 2 F 1/1335 7/027 5 0 2 G 0 3 F 7/027 7/028 7/028 7/033	1/1335 5 0 0 G 0 2 F 1/1335 5 0 0 7/027 5 0 2 G 0 3 F 7/027 5 0 2 7/028 7/028 7/033 7/033

(72)発明者 駒野 博司

神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東京応化工業株式会社内

THIS PAGE BLANK (USPTO)